

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
<p>[12]ジベンジルエーテル(別名: [(ベンジルオキシ)メチル]ベンゼン)</p>	<p>【水質】</p> <p>水質試料 1,000mL</p> <p>振とう抽出 塩化ナトリウム 30g ヘキサン 100mL (1回目)、 50mL (2回目) 注1</p> <p>脱水 無水硫酸ナトリウム</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素パージ 2mLまで</p> <p>カラムクリーンアップ フロリジル 5g 洗浄: ヘキサン 60mL 洗淨: 5%エーテル/ヘキサン 5mL 溶出: 5%エーテル/ヘキサン 20mL</p> <p>精製が必要な場合</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素パージ 1mLまで</p> <p>定容 1mL 注1 注3</p> <p>内標準添加 フェナントレン-d₁₀ 1mg/L 50µL</p> <p>GC/MS^{注2}-SIM^{注3}</p> <p><注>次に示す方法を採用した例もあった。 1:海水試料からの抽出作業は、上記記載の2分の1のスケールで行った。振とう抽出をヘキサン50mL×2回に、最終液量を0.5mLにした。また、測定機器としてGCはHP5890 II plus、MSはJMS-AMII 15を使用した。 2:測定機器としてGCはTrace GC Ultra、MSはPolaris Qを使用し、SCANモードで測定した。 3:定容は0.3mLとした。また、カラムはDB-5MSを使用し、HRGC/HRMSで測定した。 4:測定機器としてGCはVarian 3800、MSはVarian2000を使用した。 5:測定機器としてMSはAutomass Sunを使用した。</p>	<p><分析原理> GC/MS-SIM^{注2 注3}</p> <p><検出下限値> 【水質】(ng/L) [12] 1.9</p> <p><分析条件> 機器 GC: HP 6890^{注1 注2 注4} MS: HP 5973 MSD^{注1 注2 注4} ^{注5}</p> <p>カラム BPX35^{注3} 30m×0.25mm、0.25µm</p>
「平成18年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠		

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[12]ジベンジル エーテル(別名: [(ベンジルオキシ) メチル]ベンゼン)	<p>【水質】</p> <pre> graph TD A[水質試料 500mL] --> B[精油定量器を用いた抽出 沸騰石 ヘキサン 10mL] B --> C[脱水 無水硫酸ナトリウム] C --> D[濃縮 窒素バース 2mLまで] D --> E[カラムクリーンアップ フロリジル 5g 洗浄: ヘキサン 60mL 洗浄: 5%エーテル/ヘキサン 5mL 溶出: 5%エーテル/ヘキサン 20mL] E --> F[濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素バース 0.5mLまで] G[内標準添加 フェナントレン-d10 1mg/L 25μL] --> F F --> H[定容 0.5mL] H --> I[GC/MS-SIM] </pre> <p>精製が必要な場合</p>	<p><分析原理> GC/MS-SIM</p> <p><検出下限値> 【水質】(ng/L) [12] 1.9</p> <p><分析条件> 機器 GC : HP 6890 MS : HP 5973 MSD カラム BPX35 30m×0.25mm、0.25μm</p>

「平成18年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠及び分析機関報告

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
<p>[12]ジベンジルエーテル(別名: [(ベンジルオキシ)メチル]ベンゼン)</p>	<p>【底質】</p> <p>底質試料 湿泥 (乾泥換算約10g)</p> <p>振とう抽出 アセトン 50mL</p> <p>超音波抽出 10分間</p> <p>遠心分離 2,000rpm、10分間</p> <p>2回繰り返す</p> <p>振とう抽出 5%塩化ナトリウム溶液 500mL ヘキサン 50mL×2回</p> <p>洗浄 精製水 50mL</p> <p>脱水 無水硫酸ナトリウム</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素ハース 2mLまで</p> <p>カラムクリーンアップ フロリジル 5g 洗浄: ヘキサン 60mL 洗浄: 5%エーテル/ヘキサン 5mL 溶出: 5%エーテル/ヘキサン 20mL</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素ハース 1mLまで</p> <p>内標準添加 フェナントレン-d₁₀ 1mg/L 50μL</p> <p>定容 1mL</p> <p>GC/MS-SIM^{注2}</p> <p><注>次に示す方法を採用した例もあった。 1:測定機器としてGCはHP5890 II plus、MSはJMS-AMII 15を使用した。 2:HRGC/HRMSで測定した。 3:測定機器としてGCはVarian 3800、MSはVarian2000を使用した。 4:測定機器としてMSはAutomass Sunを使用した。</p> <p>「平成18年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	<p>備考</p> <p><分析原理> GC/MS-SIM^{注2}</p> <p><検出下限値> 【底質】(ng/g-dry) [12] 0.18</p> <p><分析条件> 機器 GC: HP 6890^{注1 注3} MS: HP 5973 MSD^{注1 注3 注4} カラム BPX35 30m×0.25mm、0.25μm</p>

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
<p>[12]ジベンジルエーテル(別名: [(ベンジルオキシ)メチル]ベンゼン)</p>	<p>【底質】</p> <p>底質試料 湿泥 (乾泥換算約10g)</p> <p>精油定量器を用いた抽出 精製水 300mL 沸騰石 ヘキサン 10mL</p> <p>脱水 無水硫酸ナトリウム</p> <p>濃縮 窒素バース 2mLまで</p> <p>カラムクリーンアップ フロリジル 5g 洗浄: ヘキサン 60mL 洗浄: 5%エーテル/ヘキサン 5mL 溶出: 5%エーテル/ヘキサン 20mL</p> <p>精製が必要な場合</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素バース 1mLまで</p> <p>定容 1mL</p> <p>内標準添加 フェナントレン-d₁₀ 1mg/L 50μL</p> <p>GC/MS-SIM</p> <p>「平成18年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠及び分析機関報告</p>	<p><分析原理> GC/MS-SIM</p> <p><検出下限値> 【底質】(ng/g-dry) [12] 0.18</p> <p><分析条件> 機器 GC: HP 6890 MS: HP 5973 MSD カラム BPX35 30m×0.25mm、0.25μm</p>